

## 本期封面



2001年6期

栏目:

DOI:

论文题目: 柱状晶界面对溅射NiAl微晶涂层高温氧化性能的影响

作者姓名: 杨松岚 王福会 朱圣龙

工作单位: 中国科学院金属研究所金属腐蚀与防护国家重点实验室, 沈阳110016

通信作者: 杨松岚

通信作者Email: [yssl@icpm.syb.ac.cn](mailto:yssl@icpm.syb.ac.cn)

文章摘要: 利用TGA, SEM对NiAl微晶的涂层在空气中1000 °C恒温及循环氧化过程中柱状晶界面所起的作用进行了研究结果发现, 柱状晶界面微孔在氧化初期作为自由表面严重影响了初始氧化动力学, 同时柱状晶界面氧化物微钉的形成大大提高了氧化膜的粘附性建立了基于柱状晶界面的附加自由表面数学模型

关键词: NiAl微晶涂层, 柱状晶界面, 氧化

分类号: TG174.2

关闭